

平成16年度大学院工学研究科（博士前期課程）専門試験問題 回答例

問題11 静電磁界・定常電流

解答はSI単位系を用い、真空中の誘電率と透磁率を、それぞれ $\epsilon_0$ 、 $\mu_0$ とする。

問1 解答

(1) 球殻は接地されているため、球殻の電位は0であり、球殻の外側には電界は存在しない。また、導体の内部では電界及び電束密度は0となるため、電界と電束密度は $a < r < b$ の範囲にのみ存在する。導体と球殻の配置の対称性から、電界と電束密度は原点 $o$ を中心とした球面上で一定であり、それらの方向は球面の法線と平行となる。また、半径 $r$ が $a < r < b$ である球面を通過する電束線の総数は、この球面上の電束密度の強さを $D$ として、 $D(r)4\pi r^2$ であり、この値は球面の内部にある実電荷 $Q$ と等しい。従って、 $a < r < b$ の範囲で、 $D = \frac{Q}{4\pi r^2}$ となる。誘電率が $\epsilon$ の物質中では、電界の強さ $E$ は $D = \epsilon E$ の関係より求まる。

$r < a$ は導体の中なので、 $E = 0$ 、また $D = 0$ となる。

$a < r < t$ では、電束線は上で述べたように、 $D = \frac{Q}{4\pi r^2}$ である。 $D = \epsilon_1 E$ より、電界は $E = \frac{Q}{4\pi \epsilon_1 r^2}$ となる。

$t < r < b$ では、 $D = \frac{Q}{4\pi r^2}$ であり、電界は $E = \frac{Q}{4\pi \epsilon_2 r^2}$ となる。

電位 $V$ は、電界の対称性より $r$ のみに依存するので、半径 $r$ の球面上の電位 $V(r)$ は、次式で与えられる。

$$V(r) = - \int_{\infty}^r E dr \quad (1)$$

式(1)に上で求めた $E(r)$ を代入し、電位を計算する。

$b < r$ では $V = 0$ である。

$t < r < b$ では、

$$V(r) = - \int_b^r E dr = \frac{Q}{4\pi \epsilon_2} \left( \frac{1}{r} - \frac{1}{b} \right) \quad (2)$$

$a < r < t$ では、

$$V(r) = - \int_t^r E dr - \int_b^t E dr = \frac{Q}{4\pi \epsilon_1} \left( \frac{1}{r} - \frac{1}{t} \right) + \frac{Q}{4\pi \epsilon_2} \left( \frac{1}{t} - \frac{1}{b} \right) \quad (3)$$

となる。

$r < a$ では、電界は0であり、電位は一定となる。これを $V_0$ とおくと、 $V_0$ は(3)式に $r = a$ を代した値となる。

$$V_0 = \frac{Q}{4\pi \epsilon_1} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{t} \right) + \frac{Q}{4\pi \epsilon_2} \left( \frac{1}{t} - \frac{1}{b} \right) \quad (4)$$

電束密度と電界、および電位の  $r$  依存の概略を図1に与える。

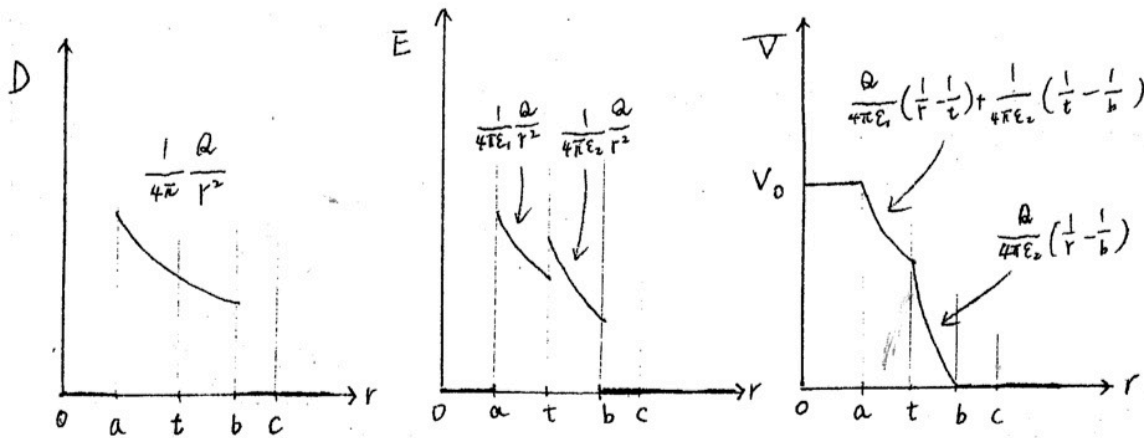


図1：電束密度の強さ  $D$ 、電界電界の強さ  $E$  および電位  $V$  の  $r$  依存の概略

(2) 導体球と導体球殻との電位差は式(4)で表される、この二つの導体間の静電容量  $C$  は、 $V_0 = Q/C$  より次式で与えられる。

$$C = \frac{4\pi}{\frac{1}{\epsilon_1}(\frac{1}{a} - \frac{1}{t}) + \frac{1}{\epsilon_2}(\frac{1}{t} - \frac{1}{b})} \quad (5)$$

(3)  $Q > 0$  の場合には、電界が最大となるところは、 $a < r < t$  の範囲では  $r = a$  にあり、 $t < r < b$  では  $r = t$  にある。従って、各々の範囲における電界の最大値が一致する条件は、 $\epsilon_1 a^2 = \epsilon_2 t^2$  となる。 $Q < 0$  の場合は、 $\epsilon_1 t^2 = \epsilon_2 b^2$  となる。

## 問2 解答

磁界と磁束密度は、導体及び電流の幾何学的な対称性から  $z$  に依らず、 $xy$  面内においては、原点を中心とする円上で一定の大きさを持ち、それらの方向は、その円の接線方向と平行であることがわかる。磁界と磁束密度のベクトルの向は、電流の向きが  $+z$  であれば、円を上方から見て反時計方向となる。

磁界と磁束密度の強さを、それぞれ  $H$  と  $B$  で表す。

$r > R$  の領域では、定常電流に対するアンペールの法則より、半径  $r$  の円に沿って磁界を線積分した  $2\pi r H$  は円内を  $+z$  方向に流れる電流  $J$  に等しい。従って、 $H = \frac{J}{2\pi r}$  となる。また、 $B = \mu_0 H$  より、磁束密度は  $B = \frac{\mu_0 J}{2\pi r}$  となる。

$r < R$  では、半径  $r$  の円に沿って磁界  $H$  を線積分した  $2\pi r H$  は円の内部を  $z$  方向に流れる電流  $\frac{Jr^2}{R^2}$  に等しい。従って、 $H = \frac{Jr}{2\pi R^2}$  となり、磁束密度は  $B = \frac{\mu_0 Jr}{2\pi R^2}$  となる。

## 問題 2 2 電磁気・電磁波

## 1. 解答

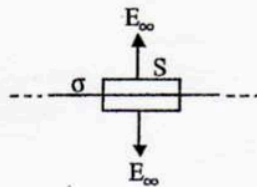
(1) 平板が無限大なので、空間電界は平板からの距離に無関係で一様であり、平板に垂直する方向である。図のように平板をまたぐ長方体（上下面の表面積がそれぞれ  $S [\text{m}^2]$ ）の表面上で積分型のガウスの定理  $\int_S \mathbf{E} \cdot \hat{n} dS = \frac{Q}{\epsilon_0}$  ( $\hat{n}$ : 法線単位ベクトル,  $Q$ : 電荷量 [C]) を適用すると,

$$E_{\infty} S + E_{\infty} S = \frac{\sigma S}{\epsilon_0}$$

を得る。これより,

$$E_{\infty} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad [\text{V/m}]$$

である。



(2)  $O$  を原点とした円柱座標で考えれば、円板平面の微小積分面積  $dS$  は  $dS = r d\theta dr$ , 点  $P$  までの距離  $d$  は  $d = \sqrt{z^2 + r^2}$  である。従って,  $dS$  上の電荷による点  $P$  での電位は,

$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma dS}{d} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma r dr d\theta}{\sqrt{z^2 + r^2}}.$$

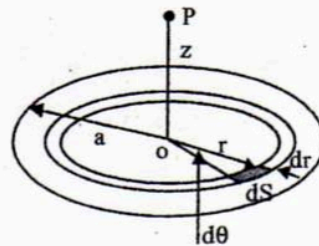
$dV$  を全円板平面にわたって積分すると,

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^a \frac{\sigma r dr d\theta}{\sqrt{z^2 + r^2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^a \frac{r dr}{\sqrt{z^2 + r^2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{z^2 + a^2} - z) \quad [\text{V}]$$

それ故に, 点  $P$  での電界  $E_a$  は

$$E_a = -\frac{\partial V}{\partial z} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left( 1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + a^2}} \right) \quad [\text{V/m}]$$

である。



(3)  $E_a = E_{\infty} / 2$  から,

$$\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left( 1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + a^2}} \right) = \frac{\sigma}{4\epsilon_0}$$

$$\sqrt{z^2 + a^2} = 2z$$

$$a^2 = 3z^2.$$

## 2. 解答

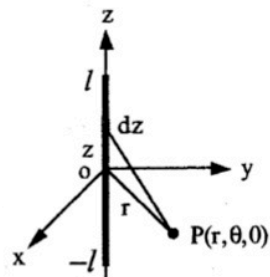
(1) ベクトルポテンシャルは、線要素  $dz$  が  $z$  方向しかないので  $z$  成分だけをもつ。すなわち、 $A_r = A_\theta = 0$  である。

線要素  $dz$  によるベクトルポテンシャルは

$$dA_z = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idz}{\sqrt{z^2 + r^2}}.$$

これを  $z$  に沿って、 $-l$  から  $l$  まで積分すると、

$$A_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-l}^l \frac{dz}{\sqrt{z^2 + r^2}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \log \left| \sqrt{z^2 + r^2} + z \right| \Big|_{z=-l}^{z=l} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \log \left( \frac{\sqrt{r^2 + l^2} + l}{\sqrt{r^2 + l^2} - l} \right)$$



を得る。

(2) 円柱座標を用いると、 $A_r = A_\theta = 0$  で、 $A_z$  は  $\theta$  を含まないから、

$$\begin{aligned} H_\theta &= \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times A)_\theta = \frac{1}{\mu_0} \left( \frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) = -\frac{1}{\mu_0} \frac{\partial A_z}{\partial r} \\ &= -\frac{I}{4\pi} \frac{\partial}{\partial r} \left[ \left( \log \sqrt{r^2 + l^2} + l \right) - \left( \log \sqrt{r^2 + l^2} - l \right) \right] \\ &= \frac{I}{2\pi r} \frac{l}{\sqrt{r^2 + l^2}} \quad [\text{A/m}] \end{aligned}$$

$$H_r = \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times A)_r = \frac{1}{\mu_0} \left( \frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) = 0$$

$$H_z = \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times A)_z = \frac{1}{\mu_0} \left( \frac{1}{r} \frac{\partial (r A_\theta)}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) = 0$$